#### 解説



## X線・中性子小角散乱法による微細組織の定量評価

大沼正人\*1, 鈴木淳市\*2

# Quantitative Analysis of Microstructures by Small-Angle X-Ray and Neutron Scattering

Masato Ohnuma and Jun-ichi Suzuki

#### Synopsis

Small-angle scattering is one of simplest methods to evaluate the average size and volume fraction of precipitates in the metals and alloys. The accuracy of the evaluated size is higher than 5 % if the analysis is proceeded in the proper way. In comparison with powder diffraction, however, there are some differences in the way to measure and analyze the small-angle scattering although the principle of the phenomena are same in both way. The key issues for measurements and analysis of small-angle scattering are overviewed and the results for high nitrogen martensitic steel are shown as an example.

## 1. はじめに ~小角散乱法で何がわかる?~

X線による粉末回折実験は金属材料研究の第 1 歩として欠かせない手法である。多くの粉末回折実験では回折角度 2  $\theta$  が  $10 \sim 20^\circ$ 以上の領域を測定するのに対し、小角散乱実験では名前の由来どおり、散乱角 2  $\theta$  が  $3 \sim 5^\circ$ 以下の領域を測定する。小角散乱測定装置の性能を現す指標の 1 つに「どの位小さな角度まで測定可能か?」がある。市販の装置では  $0.1^\circ$  程度まで到達可能であり、このような散乱角度領域を測定するために小角散乱測定装置は粉末回折装置とは異なる以下のような特徴を有する。

- a) プローブビーム(X 線または中性子線)の発散角を抑えるため、2 ないし 3 個のコリメータ(またはスリット)間の距離を大きく取っている。 コリメータ系の総長が X 線では 1 m 前後、中性子では 10 m 程度におよぶ装置が多い。
- b) 小角領域の測定を精度良く行うため、試料から検出器までの距離をプローブビームサイズと比較して十分大きくしている. X線では数10 cm から数 m 程度、中性

子では数mから 20m程度まで用途に合わせて選択される.

- c) 小角領域では空気による散乱が無視できない.このため、コリメータ部から検出器までのプローブビームパスを真空にして測定する.(ビームパスの長さにもよるが X線ではロータリーポンプ程度の真空度 (~1 Pa)で空気散乱はほぼ抑えることができる.)
- d) 同じ角度領域を取り扱う反射率測定や斜入射小角 散乱 (GI-SAS) 測定と異なり,通常の小角散乱測定では 透過配置で測定する.

このため、小角散乱装置は粉末回折装置とは異なった装置外観となるが、小角散乱法でも測定するものは X 線または中性子強度の散乱角度依存性であり、粉末回折法と何ら違いはない。

粉末回折法では複数のピークが出現し、その位置から構成相の結晶構造を決定する。ピーク位置は結晶の周期、すなわち面間隔 d に対応しており、これを端的に示すのが Bragg の式

 $2dsin \theta = n \lambda$  (1) である. 式 (1) では同じ d に対し、波長  $\lambda$  が異なれば散

#### 2008年4月22日受付

<sup>\* 1</sup> 独立行政法人 物質・材料研究機構 量子ビームセンター中性子散乱研究グループ, 博士(工学)(Dr., Neutron Scattering Group, Quantum Beam Center National Institute for Materials Science (NIMS))

<sup>\* 2</sup> 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 J-PARC センター 物質・生命科学ディビジョン 中性子利用セクション,博士(理学) (Dr., Materials and Life Science Facility Division J-PARC Center, Japan Atomic Energy Agency (JAEA))

乱角  $2\theta$  が異なるため、いろいろな波長を使う小角散乱 法では不便である。そこで、実空間のスケール(ここで は d)に一対一に対応するパラメータとして波数 q を次 のように定義する。

さて, 金属材料の場合, 小角散乱法の主たる使用目 的は析出物などの第2相粒子の平均サイズの決定にあ る. これは粉末回折法において回折ピークの広がりから Sherrer の式などを用いて粒子径(結晶粒子サイズ)を求 める方法に対応する. どちらの手法でもサイズが決定で きる原理は基本的に同じであり、 粉末回折法ではある回 折面での回折ピークの広がりからサイズを決定している のに対し、小角散乱法ではq=0に散乱されたピークの 広がりからサイズを決定する. このため, 小角散乱法で は面間隔 d という周期性を前提としておらず、測定対象 とする第2相粒子が非晶質であっても、ボイドであって も測定が可能である. さらに, 小角散乱測定装置は粉末 回折装置と比較してビームの平行性が極めて高く、装置 起因のピーク幅の広がりは小角散乱の半価幅と比較して 小さいこと, 面間隔 d の不完全性, すなわち格子ひずみ に起因するピーク幅の広がりがないことといった条件か らピーク幅にはサイズ以外の情報がほとんど含まれない. 従って、平均サイズの決定精度が高く、サブナノメータ の精度で平均サイズを評価できる.

粉末回折法においては、ほとんどの場合、散乱強度を 任意単位で測定するが小角散乱法では標準試料を使って 絶対化した散乱強度(微分散乱断面積)で測定すること が多い、絶対化した散乱強度で測定を行えば、測定対象 とする析出物などの第2相粒子の数密度や体積分率を決 定することができる。

以下の章では、これらの特徴を金属材料研究に活用するために必要な実践的な情報を計算プロファイルや高窒素マルテンサイト鋼の焼戻し過程についての研究りを例

に引きながら記述する。その他の測定例、小角散乱の原理の詳細、国際的な動向などについては文献  $^{2)\sim40}$  などを参考にされたい。

## 2. 実験方法 ~小角散乱実験に必要なこと~

本報で紹介する例は、大同特殊鋼(㈱において加圧溶解法により作製した 16Cr-1.1Mo-0.2V-0.1C-0.6N (mass%) 高窒素マルテンサイト鋼である.この合金をサブゼロ処理  $(-76\, ^{\circ}\, ^{\circ$ 

#### 2. 1 試料厚さと透過率

小角散乱測定は通常, 試料透過型の配置で行う. した がって、ビーム照射領域内部の試料厚を調整し、適切な 透過率を確保する必要がある. 鉄鋼材料に対する中性子 の透過力は強く、SANS-J-II で使用する波長( $\lambda = 0.6 \text{ nm}$ ) では、試料厚さ2 mm を標準としている. これに対し、 鉄鋼材料の X 線に対する吸収係数は格段に大きく、測定 には試料の薄膜化が必要である. 特に, 通常用いられる Cu-Kα線源 (λ = 0.154 nm) の場合は鉄元素の吸収端に 近いため, 透過力が極めて小さく(10 μmで10%以下), 蛍光X線も発生する. 小角散乱測定の場合. 弱いシグナ ルを有効に活用する必要があり、2次元の位置敏感型検 出器を使用することが多い. その場合, 構造上モノクロ メータ(アナライザ結晶)を設置することができないた め、蛍光X線によるバックグラウンドレベルの著しい増 加が生じる. そのため、ラボ X 線源を用いた鉄合金の測 定には Cu-Kα線源は使用できない. さらに. ステンレス 鋼の場合, 多量の Cr を含むため, Co-Ka線源( $\lambda$ =0.179 nm) も利用に適さず、Mo-K $\alpha$ 線( $\lambda$  = 0.0709 nm)また は Cr-K  $\alpha$  線 ( $\lambda$  = 0.229 nm) を使用することが必要とな る. 放射光の場合は構成元素を考慮して適切なエネルギー を選択して測定を行う. どちらの場合も測定に使用する 波長に対して最適な試料厚さをあらかじめ把握する上で. 実験前に測定対象合金の線吸収係数  $\mu_s$  を計算しておくと よい、X線の場合、文献 $^{5,6}$ に与えられている質量吸収 係数  $(\mu / \delta)$ , 試料組成 $C_w$  (重量分率) と試料密度  $\delta_s$  か ら線吸収係数 $\mu_s$ を次式で求めることができる.

$$\mu_{s} = \delta_{s} \sum_{s} \left( \frac{\mu_{\delta}}{\delta} \right) \cdot C_{w}$$
 (4)

本報で報告する高窒素マルテンサイト鋼の場合,実験に用いた Mo-Ka線に対する各元素の質量吸収係数は Table 1 に示したとおりであり, $\delta_s$ =7.68 g/cm³ であるので,本合金の線吸収係数 $\mu_s$ は 282 cm¹ となる.入射ビーム強度  $I_0$  と透過ビーム強度 I の比で与えられる透過率 I/ $I_0$  はこの線吸収係数と試料厚さ t から次式で計算できる.

$$\frac{I}{I_0} = \exp(-\mu_s t)$$
 (5)

したがって、試料厚 30  $\mu$  m の場合の Mo-K  $\alpha$  線透過率は 24 % と求めることができる。本実験では透過率 50 % 以上を与える 20  $\mu$  m 程度まで機械研磨により薄膜化した。 鉄鋼材料の場合、X 線小角散乱測定ではビーム径が 1 mm  $\phi$  以下と小さく、ビーム照射領域の厚さをマイクロメータなどで正確に測定するのは困難であるため、実測した透過率と線吸収係数から式(5) を使って試料厚さ t を決定した。

中性子の場合は、吸収断面積  $\sigma_a$  が文献  $^{\eta_a}$   $^{8}$  に与えられているので、その値とアボガドロ数  $N_A$  および原子量 A を用いて質量吸収係数、( $\mu$  I  $\delta$ )を次式で求めることができる.

$$\binom{\mu}{\delta} = \sigma_s N_A$$
 (6)

各元素に対してこの値を計算した後は、式 (4) を用いて線吸収係数を求める。本合金の場合、Table 1 に示した値を使い、線吸収係数  $\mu_s$  を求めると 0.223 cm<sup>-1</sup> となり、2 mm 厚の試料では透過率が 95 % となる。(Table 1 の値は波長 0.18 nm の熱中性子に対する値であり、測定に使用した 0.6 nm の波長では透過率は少し小さく、81 % であった。) 小角散乱測定では試料厚さが不足している場合、複数枚の試料を重ねて測定することも可能である。

透過型の回折実験で回折強度を最も効率的に取得できる厚さとして $\mu$ t=1となる厚さが推奨されることがある.しかし、小角散乱実験ではそれよりも薄く、透過率が80~90%以上を与える厚さが望ましい.これは多重散乱の影響を低く抑えるためである.しかし、透過率の小さな

X線小角散乱実験では現実的には10%程度の透過率でも 測定することがあり、多重散乱の影響について実験結果 を慎重に吟味する必要がある.

#### 2. 2 試料サイズ・形状

測定を行う試料形状は以下の条件を満たしていれば良い

- a) ビームサイズよりも大きな面積を持っていること. 例えば NIMS の labo-SAXS のビーム径は  $0.6 \sim 1~\text{mm}~\phi$  であるので  $2~\text{mm}~\phi$ 以上の試料サイズがあれば測定可能. JAEA の SANS-J-II ではビーム径が  $10 \sim 15~\text{mm}~\phi$ であるので  $15~\text{mm}~\phi$ 以上の試料サイズが必要.
- b) ビームが照射領域内の試料厚さは均一なほど良い. 以上の 2 条件を満たし、試料ホルダにマウントできれば どのような形状でも構わない。NIMS-labo-SAXS では最大  $15 \times 30$  mm 程度、JAEA-SANS-J-II では非磁性試料測定では大きさに特に制約はないが通常は  $20 \times 20$  mm 程度、鉄鋼材料では後に述べるように磁場中で測定する必要があるのでマグネットの磁極間に収められるサイズ(最大で  $20 \times 20$  mm)以下とする。ビームサイズより大きな試料が必要な理由は試料エッジからの散乱を避けるためと次節に示す寄生散乱を差し引く精度を確保するためである。

#### 2. 3 寄生散乱の除去

小角散乱測定装置ではビームパスの真空引きによる空気散乱の低減や平行性の高いビームを取り出すためのコリメータを利用し、小角領域に可能な限り余計なシグナルが届かないように設計されている。しかしながら、それを完全に除去することは困難であり、各装置の光学系に特有の散乱が小角領域に出現するのは避けられない。このような測定光学系自身による散乱は「寄生散乱」と呼ばれている。この原因となるのは真空チャンバーのビーム取り出し窓やコリメータエッジ部分からの散乱である。これらの寄生散乱に加え、測定光学系以外に起因する散乱(周囲の装置からの X 線、中性子線)、検出器の電気

Table 1. Alloy composition and absorption factor, scattering length of each element.								
Element	С	Cr	Мо	V	N	Fe		
mass %	0.1	16.0	1.1	0.2	0.6	Bal		
at.%	0.5	16.7	0.6	0.2	2.3	Bal		
mass absorption factor $\mu / \delta$ (cm <sup>2</sup> /g) for Mo-K $\alpha$	0.625	31.1	18.4	27.5	0.916	38.5		
absorption cross section, $\sigma_a$ (fm <sup>2</sup> ) for 2200 m/s neutrons	0.350	305	248	508	190	256		
mass absorption factor, $\mu / \delta$ (cm <sup>2</sup> /g) for 2200 m/s neutrons	0.000175	0.0353	0.0156	0.0601	0.0817	0.0276		
coherent scattering length for X-ray (fm)	16.9	67.7	118	64.9	19.7	73.3		
coherent scattering length for 2200 m/s neutrons (fm)	6.6484	3.635	6.715	-0.443	9.36	9.45		

#### 2. 4 散乱強度の絶対化

1章でも述べたが、小角散乱法では散乱強度を任意単位ではなく微分散乱断面積として絶対化することで試料中に含まれる析出物などの量を定量化することができる。このためには測定装置の装置定数(ビーム強度、検出器の検出効率)を決定することが必要となる。装置定数の決定には散乱強度が既知の試料を1次標準として測定する方法、装置定数が既知の装置を用いて測定した試料を2次標準として使用し、絶対強度化を行う方法とがある。本稿で紹介する実験結果は後者の方法で絶対強度化されている。SANS-J-IIではcavityを含むAl試料、NIMS-labo-SAXSではglassy carbonを用いている。また、各試料の測定データはビームを照射した体積で規格化する必要がある。ビーム径は全ての試料で同じであるから、厚さtで規格化すればよい。絶対強度化の詳細については文献ッおよびのを参考にされたい。

#### 2.5 散乱長密度の計算

散乱強度の絶対強度化による最大のメリットは測定対象とする析出物などの粒子の体積分率、数密度などを定量化できる点である。3章式(10)(11)で触れるが、析出物量の定量化にはマトリクス、析出物のそれぞれについてプローブビームに対する見え易さを表す散乱長密度 $\rho$ を次式より求めておく必要がある。

$$\rho = \frac{N_{\text{unit}}}{V_{\text{unit}}} \sum_{element} b \cdot C_{\text{a}} \cdot \dots$$
 (7)

ここで  $N_{\rm unit}$  はマトリクス相または析出物相の体積  $V_{\rm unit}$  中の原子の数, b および  $C_{\rm a}$  はそれぞれ各構成元素の散乱長および組成(原子分率)である。例えば  $Fe_{\rm 3}C$  セメンタイト相の散乱長密度を計算する場合、 $V_{\rm unit}$  として単位胞(a=0.50787, b=0.67297, c=0.45144 nm)を取ると、 $N_{\rm unit}$  は 16個であり、Table 1 に示した C および Fe の散乱長 b (fm: 7 エムトメートル  $=10^6$  nm 単位)を使うと散乱長密度  $\rho_{Fe_{\rm 3}C}$  は中性子に対しては  $9.07 \times 10^{10}$  cm<sup>-2</sup>、X 線に対しては  $6.14 \times 10^{11}$  cm<sup>-2</sup> となる。名前のとおり、散乱長の重みを付与した密度であるため、密度に対して慣用的に使用される cm が単位として使われ、(長さ/体積)の形となるので cm<sup>-2</sup> となる。析出物の体積分率が小さければマトリクス の散乱長密度は試料の平均散乱密度  $\rho_{\rm ave}$  とすれば良いか

ら, 試料の組成分析値  $C_w$  (重量分率) と密度  $\delta_s$  から次式で計算できる.

$$\rho_{\text{ave}} = \delta_{\text{s}} \cdot N_{\text{A}} \frac{\sum_{\text{element}} \frac{b \cdot C_{\text{w}}}{A} \qquad (8)$$

次章で解説するとおり、実際に散乱強度を決定するのは各々の散乱長密度 $\rho$ そのものではなく、両者の散乱長密度差( $\Delta \rho = \rho - \rho_{ave}$ )である点が小角散乱の特徴の一つである。このため、鉄中に軽元素のクラスターが存在するような場合、中性子よりもX線で強いシグナルが出現することもある。

ちなみに、企業においては組成を明確にすることができないものの、小角散乱測定が可能かどうか検討したいというケースがあるかもしれない。その場合、まず、試料の平均散乱長密度と予想される析出物の散乱長密度を計算し、それを小角研究者に提示する(組成は伏せておく)ことで測定の可否はある程度、検討可能である。

#### 2. 6 その他, 必要な条件

SAXS 測定の場合

実験室、放射光を問わず SAXS 測定では透過率を確保 するために Bragg 回折が生じる条件内の波長領域 (λ<  $1/(2dsin \theta)$ ) で実験を行う、そのため、多重回折の影響 を少なからず受ける. この影響は強加工を施した試料や マルテンサイト鋼など、大きな歪みを内包する試料で影 響が顕著であり、q=0付近から特定の方向に放射状に伸 びるストリークとして観測される. ストリークは歪みが 内包していることに加え,同一結晶がビームパス内に存 在する可能性が高いほど、すなわち結晶粒子サイズが大 きい場合ほど発生しやすい. これを抑えるためには試料 調整の際に面直方向に晶帯軸が立たない条件で切り出す こと、もしくは試料位置をスキャンしてそのような条件 を見つけること、できるだけ薄くすることが有効である. どうしてもストリークが避けられない場合には、2次元 データ上でストリークの影響の小さい領域を解析する場 合もある. 歪みが大きな試料やマルテンサイト組織を有 する試料に対し、1次元検出器や0次元検出器の2θス キャンによる SAXS 測定を行う場合、この点に十分に注 意し、試料を回転させ、スキャン方向の違うプロファイ ル測定を幾つか行うことが必要であろう.

#### SANS 測定の場合

中性子は前述のとおり、低エネルギーでも金属材料に対する透過率が高く、定常炉を用いた実験では $\lambda > 1/(2d)$ を用いるため、多重回折の影響は生じない、一方で、オーステナイトを除く鉄鋼材料の場合、小角領域には磁区組織を反映した強い散乱がゼロ磁場中の測定で

は出現する。この状態では微細組織を反映しない磁区構造(Fig.1(a))であるため、ゼロ磁場中測定の小角散乱データは微細組織の解析には利用できない。このため、磁場を印加し、試料を磁気的に飽和させ、単一磁区組織にする必要がある(Fig.1(b))。このような状態にしてから、飽和磁化量の差を反映した磁気散乱成分と組成差を反映した核散乱成分に分離して解析する。散乱強度I(q)、磁気散乱成分 $I_{\text{magnetic}}(q)$ 、核散乱成分 $I_{\text{nuclear}}(q)$ 、プロファイル解析する方向と磁場印可方向とのなす角を $\alpha$ として以下のような関係がある。

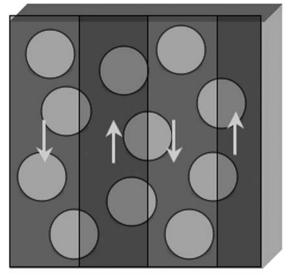
 $I(q) = I_{\text{nuclear}}(q) + \langle \sin \alpha \rangle^2 I_{\text{magnetic}}(q) \cdots (9)$ したがって、印加磁場方向に平行な成分 ( $\alpha = 0$ ) は核 散乱成分のみ、垂直な成分 (α = 90°) には磁気散乱と 核散乱との両方が含まれる。析出物などの微細組織の定 量評価には主として核散乱成分を利用するが、観測対象 によっては磁気散乱成分の利用が有効である場合も多い. 例えば、鉄中への Cu のクラスタリングの研究では強磁 性母相中へ非磁性相が形成するため, 磁気散乱成分では 観測可能であったが核散乱成分ではΔρの大きさが不十 分で観測が困難であった4. また, 析出初期段階におい て析出物中の鉄濃度が徐々に変わるような場合, 磁気散 乱成分と核散乱成分との比の変化としてこれを観測でき ることが期待される. さらに界面付近の応力状態は飽和 磁化に影響を与えるため、磁気散乱成分により決定した 析出物サイズと核散乱成分により決定したサイズとの比 較から界面の応力状態を議論できる可能性がある. これ まで磁気散乱成分を構造材料研究に活用した例は少ないが、今後、積極的に活用すべき情報といえる.

最後に中性子特有の問題として放射化がある。ある種の元素を含む試料では中性子の照射により、試料が放射化する可能性がある。しかし、小角散乱実験に使う中性子のエネルギー領域ではほとんどの場合、この問題は生じない。個々の試料に対し、実験前後で試料からの放射線量を必ずモニターする必要があるが、著者らの経験では構造材料試料で小角散乱実験後、放射化が問題になった事例はこれまで生じておらず、通常は測定後、試料を持ち帰ることが可能である。

## 3. 実験結果 ~小角散乱法の解析ポイント~

はじめに理想的な小角散乱プロファイルとして純鉄 母相中に平均粒径  $D=50~\rm nm$  で分散 s=0.2D の正規分布を有する  $Fe_3C$  が体積分率 1% で分散している場合と同じ体積分率,分散で  $D=100~\rm nm$  の SAXS プロファイルを Fig.2(a) に示す,プロファイルを詳細に検討するため,Fig.2(b) に示したように通常は両対数軸に対して散乱強度を表示している。前述のとおり,粉末回折法のブロードニングでは半価幅から粒径を計算している。同じ原理でブロードニングが生じる小角散乱プロファイルも粒径が小さい場合に半価幅が大きくなっているのが分かる(Fig.2(a))。Fig.2(b) の両対数表示では半価幅に相当する q (矢印で表示)以下で散乱強度 I(q) の q 依存性が弱

(a)



(b)

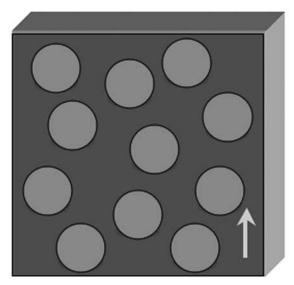


Fig.1. Schematic drawing of the relation between magnetic domain and (chemical) microstructure (a) without magnetic field (b) with a saturation magnetic field.

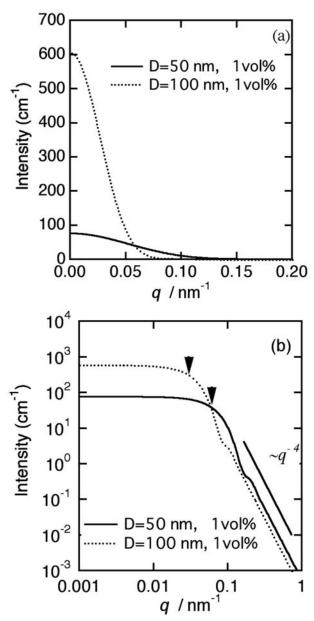


Fig.2. Calculated SANS profiles of 1 vol% Fe $_3$ C with different sizes.

く、平坦な領域が観測される。小角散乱法のサイズ決定の基本となるのはこの平坦部がqに対してどの程度まで広がっているかを評価することであり、(a),(b) の関係を比較しても分かるように、粉末回折法で行われる半価幅からのサイズ決定と基本的には変わらない。しかし、小角散乱法では最もシンプルな方法(Guinier 近似:文献 か参照)といえども半価幅をqに対する依存性を吟味しながら解析するため、精度が高い評価を行うことができる。プロファイルの統計精度、測定q 領域にもよるが通常は10 nm 以下の粒子サイズでも誤差範囲は5 % 程度かそれ以上の精度を持つ。

Fig.2 では全く同じ体積分率のFe<sub>3</sub>C を含む系に対して

散乱強度を計算している。しかしながらq=0付近の強度, I(q=0) は両者で大きく異なっている。I(q=0) の散乱強度 (q=0) に散乱されたピーク強度には試料と相互作用せずに透過した透過ビームの強度は含まない。ただし,実験的には両者を区別することは不可能であるため,q=0 近傍の散乱強度から議論する。)は粒子の数密度n, 1 個あたりの粒子の体積V(D), 粒子と母相との散乱長密度の差, $\Delta \rho$  を使って次式で与えられる。

 $I(q=0) = n \cdot V(D)^2 \cdot \Delta \rho^2 \quad \dots \tag{10}$ 粒子体積 V(D) 項が 2 乗であるのに対し、数密度 n は 1 乗 であるため、同じ体積分率 (= n V(D)) であっても q = 0近傍ではサイズの大きな粒子の寄与が大きくなる. この ことは小角散乱法における解析対象の選択性にとって. 有利に作用する. q=0 近傍の散乱, つまり小角散乱は全 ての相による散乱が重ね合わされており、ピーク位置を 起点とする粉末回折法のような相選択制は無い. これに 対し、構造材料は種々のサイズの組織を含有する階層構 造を持っている. Fig.3 には平均直径 200 nm と 5 nm の Fe<sub>3</sub>C が それぞれ体積分率 1 % と 0.5 % で混在した場合の 小角散乱プロファイル (計算結果) を示した. 前述のよ うに q=0 に近づくほど大きな粒子からの寄与が顕著にな り、q < 0.1nm<sup>-1</sup> の領域では 200 nm の Fe<sub>3</sub>C からの散乱の みが観測される.一方、Fig.2 に示したとおり、平坦部よ りも十分に high-q 側では散乱強度の q 依存性が強くなり、 ついには $q^4$ となる領域が観測される。理想的なフラクタ ル構造を除くとこのq依存性は散乱体のサイズに対して 十分に大きな q 領域を観測すればあらゆる散乱体で観測 される. Fig.3 のケースでは q > 0.02 nm<sup>-1</sup> 以上で 200 nm-

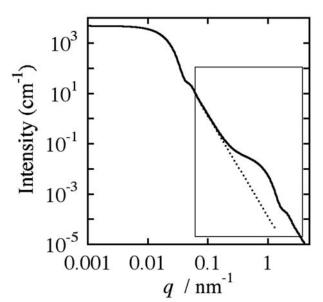


Fig.3. Calculated SANS profiles of the system including precipitates with different size.

 $Fe_3C$  からの散乱強度の減衰率が強くなり、200 nm 粒子からの寄与は q>0.1 nm<sup>-1</sup> では点線で示したレベルとなる.このため 5 nm の  $Fe_3C$  からの強度レベルの寄与が勝り、5 nm 粒子からの平坦部が観測可能となる.このように観測対象とする析出物スケールに対応する q 領域を選択すれば着目する析出物のみの情報を分離することが可能である.指数 -4 となる q 依存性を示す領域の散乱強度  $I_{high-q}(q)$  は近似的に以下のように記述できる.

$$I_{\text{high-}q}(q) = \frac{2 \pi \cdot n \cdot S \cdot \Delta \rho^2}{q^4} \qquad (11)$$

ここで S は粒子一個あたりの界面積である。十分に大きな q 領域 (以下 high-q 領域と記述)を観測した場合。同じ体積分率であればより大きな界面積を与える小粒子からの寄与が大きくなることがこの式からも示唆される。大粒子と小粒子の混在する系でサイズ差による分離が可能な条件としては下記の 2 点を目安とすると良い。

- (1) Guinier 領域の適用範囲(両対数表示の平坦部)が倍程度の high-q 側まで広がっている(つまり、粒子サイズ比が 2 以上)こと.
- (2) 次式で現される high-q 側の強度寄与率の比が大きいこと.

$$\frac{I_{\text{small}}(q)}{I_{\text{large}}(q)} = \frac{V_{\text{small}}D_{\text{large}}}{V_{\text{large}}D_{\text{small}}} \left(\frac{\Delta \rho_{\text{small}}}{\Delta \rho_{\text{large}}}\right)^2 = \frac{N_{\text{small}}}{N_{\text{large}}} \left(\frac{D_{\text{small}}}{D_{\text{large}}}\right)^2 \left(\frac{\Delta \rho_{\text{small}}}{\Delta \rho_{\text{large}}}\right)^2$$
(12)

ここで、下付き文字 small, large がそれぞれ小粒子と大粒子を意味し、I(q) が各粒子からの散乱強度の寄与、V、N, D,  $\Delta \rho$  がそれぞれの体積分率、数密度、粒子径、母相と析出物の散乱長密度差である。この比が 10 以上であると比較的容易、かつ良い精度で大粒子と小粒子を分離できる可能性が高い、大粒子と小粒子が同じ濃度であれば  $\Delta \rho$  の比は 1 となる。したがって、粒径比が 2 の場合は小粒子の体積分率が大粒子の 5 倍程度(小粒子の数密度が大粒子の 40 倍)、粒径比が 10 の場合は体積分率が大粒子と同程度(数密度で 1000 倍)あれば分離できることになり、サイズ差が大きいほど小さな体積分率の小粒子も検出可能となる。

Fig.3 では幅広い q 領域に渡りプロファイルを計算しているが実測可能であるのはこのうちの特定の領域である。例えば、図中に四角で示した領域を観測範囲と仮定すると、有効な情報を取り出せるのはナノサイズの析出物に対しのみである。200 nm-Fe<sub>3</sub>C からの散乱は平坦部が観測範囲の外にあり、 $q^4$  領域が観測されるのみである。式(8) から  $\Delta p$  が既知であればこの領域から粒子と母相の界面積を求められるが、サイズがわからなければ数密度が

決定できないので体積分率も求められない. したがって,このケースでは  $200 \text{ nm-Fe}_3\text{C}$  からの散乱から有効な微細組織情報を得ることは困難であり、単に  $q^4$  の依存性を持ったバックグラウンドとして取り扱うことになる.

次に高窒素マルテンサイト鋼の焼戻し過程を例に解析の実例を紹介する。Fig.4 に中性子小角散乱 (SANS) の測定結果(核散乱成分)を示す。本研究ではサブゼロ状態で粒径 200 nm 程度の未固溶の炭窒化物が存在しており、この未固溶炭窒化物からの散乱が平坦部から high-q 側の $q^4$  領域まで、全域に渡り観測されている。したがって、ここから未固溶炭窒化物の平均サイズを決定でき、析出物の濃度および結晶構造が既知であればその絶対量が決定できる。この  $q < 0.03 \ \mathrm{nm}^{-1}$  領域の散乱強度は 500  $\mathbb C$ 以下の熱処理ではほとんど変化していない。つまり、未固溶炭窒化物のサイズ、体積分率は変化が無いことが分かる(式 (10)(11) 参照)。この情報は次に述べるナノサイズの組織変化の解析を行う意味で極めて重要である。

Fig.4のq > 0.5 nm<sup>-1</sup>の領域に着目すると 500 ℃以上で散乱強度が強くなることが観測される。未固溶炭窒化物からの散乱の平坦部よりも 2 桁近く大きな q 領域の散乱であり、実空間スケールではその逆数として 2 桁近い小さなサイズに対応し、数 nm スケールで微細組織に変化が生じていることを示している。しかしながら、この部分を詳細に解析するにはより high-q 側の観測が必要である。定常炉を利用した中性子小角散乱測定装置では冷中性子(長波長の中性子)を使う装置が多い。式(2)より明らかなように、長波長を利用すると特定の装置構成で到達可能な low-q 側の限界値は小さくなり、大きな析出

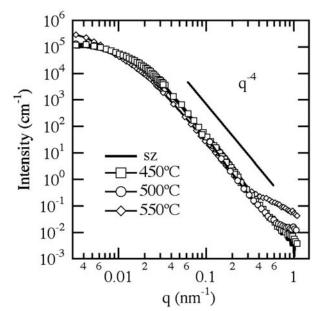


Fig.4. SANS profiles of the high-N martensite with different tempering conditions. "sz": subzero sample.

物の観測には有利となるが、high-q 側の測定には必ずし も適していない. 広い q 範囲 (特に high-q 側) を測定す るには、多数の波長の中性子を同時に利用するパルス中 性子源に設置された小角散乱装置の方が有利である. 国 内では高エネルギー加速器機構(KEK)においてパルス 中性子源が2006年まで利用できたが、既に運転を終了 している. 現在, その後継として世界的にも最高レベル の輝度を誇る J-PARC の建設が進んでおり、2008 年 12 月 から中性子散乱測定装置の一部が供用開始される10)~15). J-PARC における小角散乱測定では high-q 側の測定も高い S/N 比で可能となる.

さて、現状ではこの領域の情報を得るためには短波長 の Mo-K  $\alpha$  線 ( $\lambda$  = 0.07093 nm) を利用している. 2.1 節 で述べたとおり、SANS 測定が非破壊で行えるに対し、 SAXS 測定では 20  $\mu$  m 程度までの薄膜化を必要とするた め、完全な非破壊検査法とはいえない、しかし、サブミ クロンスケールまでの薄膜化が必要な電子顕微鏡試料や 先端が数 nm 程度のアトムプローブ試料と比べると依然 としてバルクに近い状態であり、X線の照射領域に相当 する  $1 \text{ mm } \phi \times 20 \mu \text{ m}$  の領域の平均情報を得ることがで きる点で有利である. Fig.5 にサブゼロ試料, 種々の温度 で焼戻した試料の SAXS プロファイルを示す. サブゼロ 試料では SANS プロファイルに見られたと同様、未固溶 炭窒化物からの散乱によるq依存性の大きな強度減衰が 見られ、そのまま蛍光X線などによる q 依存性の無いバッ クグラウンドにつながっている. これに対し、焼戻し試 料ではサブゼロ試料と比較して明瞭な変化が q>1 nm-1 の 領域に観測される。特に、SANS 測定では観測領域の制約

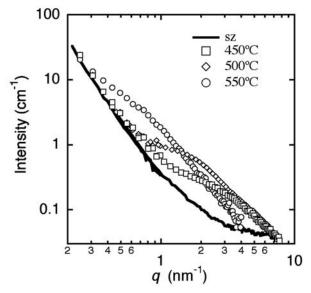


Fig.5. SAXS profiles of the high-N martensite with different tempering conditions "sz": subzero sample.

から変化が見られなかった 450 ℃の焼戻しでも SAXS 強 度に顕著な差が見られ、微細構造に nm スケールの明瞭 な変化が生じていることが明らかとなった. この温度で の焼戻しでは硬さが向上するのにも関らず、耐食性が劣 化しないことが濱野らにより報告されている16. 高窒素 マルテンサイトステンレス鋼の焼戻し過程における硬さ 変化と微細組織変化は他にも幾つかの報告例 17), 18) があ るが、いずれも450~500℃付近に硬さのピークを示し ている. これらの報告例では過時効試料で窒化物の形成 が報告されているものの, 硬さピーク付近では明瞭な組 織変化は報告されていなかった. この理由の一つとして, 透過電子顕微鏡(TEM) などの直接観察手法ではゼロ(何 も無い)状態から生じた変化は極めて明瞭かつ感度良く 分離できるものの, 既に何か存在している状態 (この例 では未固溶炭窒化物の存在) に加えて微細組織の変化が 生じる場合には小さな変化を見つけ難い点が挙げられる. 一方、小角散乱法ではプロファイルの比較として異なる 熱処理条件の試料間の比較が容易である. 特に, 本試料 のように既存組織が注目する熱処理条件の変化範囲で安 定であるため、新たに生じた組織変化分に対応する強度 変化を極めて明確に観測可能である. 本合金の場合, ナ ノスケール変化の解析にとってはバックグラウンドとな るサブゼロ試料の散乱プロファイルを各焼戻し試料から 差し引いてやることで、焼戻しにより生じた微細組織変 化を簡単に抽出することができ、その結果を Fig.6 に示 した. Fig.6 では平坦な領域より high-q 側の散乱プロファ イルの q 依存性は析出物などの散乱体の形状を反映し, 特徴的なq依存性を示している。大きさと形状が既知の

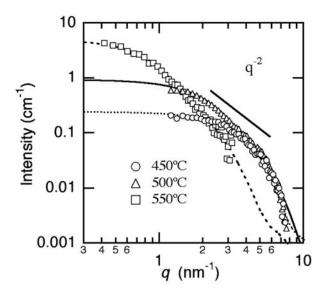


Fig.6. SAXS profiles of the high-N martensite with different tempering conditions subtracted by the profile of subzero

小角散乱プロファイルは理論的に計算可能であり、代表 的な形状(球,円盤状,円柱状,直方体など)について は簡単に小角散乱プロファイル理論式(形状因子)が導 出可能で種々の文献にも与えられている2. 実際の系に おいては複雑な形状の析出物をこれら単純な形状に対す る形状因子を用いて近似し、サイズ分布も取り込んで計 算することで必要な微細組織情報を得るという流れで 我々は金属材料の微細組織解析を行っている. 本系の場 合,450℃試料では球の形状因子を使ってフィッティン グ可能であるのに対し、500℃、550℃焼戻し試料では球 形ではフィッティングが困難である. 500 ℃焼戻し材の プロファイルには平坦部より high-q 側において円盤状の 散乱体に特有の q 依存性である指数-2 の依存性が観測で きる. 550  $\mathbb C$ では明瞭な  $q^2$  領域は出現しないが平坦部か ら q4 至る中間域において、指数-2 に近い値で q 依存性 が連続的に変化している傾向が見られる. このような傾 向を示す形状は回転楕円体である可能性が高い. そこで, 球,円盤,楕円体に対する形状因子を用い,フィッティ ングを行った例を点線、実線、破線で Fig.6 に、得られた 組成不均一領域の平均サイズを Table 2 にそれぞれ示し た. サイズ分布については正規分布を仮定し、分散幅を 0.1 nm (球および楕円体), 0.2 nm (円盤の底面のみ, 厚 さは単分散)として固定し、フィッティングを行った. 観測プロファイルのq範囲を広く取れた場合や形状が既 知である場合、また、振動項が観測できた場合にはサイ ズ分布をフィッティングから求めることもできる. しか し、このようなケースは鉄鋼材料ではまれであり、通常 は TEM 観察の情報を取り入れた値とするか、フィッティ ング時に問題を生じやすい振動項(単一サイズの粒子で 出現する)を抑制する程度の分布幅で固定し、解析を行 う場合が多い. TEM 観察が現在まで成功していない本 系の場合には後者に相当する. 円盤形状は MX 型 (NaCl 型)のナノサイズの整合析出物でしばしば観測される形 状であり、本系でも出現可能性がある CrN などの窒化物 である可能性が高い. 500 ℃焼戻し材では孔食電位が低 下し、本合金の特徴の一つである耐食性が失われている ことからも Cr 元素が窒化物によって消費されていると考 えられ、CrN に近い組成の MX 型窒化物の形成が推測さ れる. また, 550 ℃では TEM 観察の結果, 比較的大きな Cr<sub>2</sub>N の粒界への析出が確認されている. これと比較する と SAXS プロファイルで観測された粒子サイズは小さく, 高数密度であるため、粒内にも同種の窒化物が形成して いる可能性が高い.一方,500℃以上の焼戻し温度で形 成した組成不均一(前述のとおり、窒化物と推測)サイ ズと比較すると450℃の焼戻し材で形成した組成不均一 領域は小さく, 直径が 1 nm 程度の球近似が可能である. 式(10)に示したとおり、散乱長差が決定できればこの1 nmの散乱体の数密度を決定することができる.しかし、 そのためには形成した散乱体の結晶構造と濃度を決定す る必要があり、電子回折や X 線回折による相の同定、ア トムプローブ (AP) などによる組成情報が必要となるが、 現在までのところ、TEM、APともこの相の形成を捉える ことに成功していない. そこで, この「直径 1 nm 程度の 組成不均一領域」を一連の窒化物形成の前駆段階である と考え、可能性のある幾つかの Fe 窒化物や Cr 窒化物の 散乱長密度を計算し、数密度を見積った. 計算に用いた 散乱長密度は Table 3 に示してある. これらのうち マト リクスと最も大きな散乱長密度差を与え, 数密度が最小

Table 2. Average size of heterogeneity formed by tempering.

焼戻し温度 (℃)	450	500	550			
形状	球状	円盤状	回転楕円体			
平均サイズ (nm)	1.0(直径)	1.7(直径) 0.6(厚さ)	6.0(主軸) 1.4(短軸)			

Table 3. Scattering length density for possible nitride formed in the studied alloy.

nitride	Fe <sub>4</sub> N	CrN	Cr <sub>2</sub> N	matrix
格子定数(nm)	a=0.379 NaCl 型	a=0.414 NaCl 型	a=0.475, c=0.443, 六方晶	from composition
単位胞内の原子数	5	8	9	
散乱長密度 (cm <sup>-2</sup> ) 中性子 (λ =0.18 nm) X 線 (Mo-Kα)	8.66 × 10 <sup>10</sup> 5.75 × 10 <sup>11</sup>	7.33 × 10 <sup>10</sup> 4.93 × 10 <sup>11</sup>	5.74 × 10 <sup>10</sup> 5.38 × 10 <sup>11</sup>	8.02 × 10 <sup>10</sup> 6.14 × 10 <sup>11</sup>
450 ℃の SAXS 強度に必要な 体積分率	0.2	0.025	0.06	

となる CrN で計算した結果でも  $0.045 \text{ nm}^3$ (粒子間隔が 3 nm 程度に相当)という高密度で存在していることが予想される.  $\text{Cr}_2\text{N}$  の場合はコントラストが小さくなるので観測された散乱強度を説明するためには数密度が大きくなり,  $0.11 \text{ nm}^3$  となる. また,熱処理温度による数密度の変化を概観する目的で散乱長密度差が熱処理温度によらず一定であると仮定すると 550 C 焼戻し材の数密度は 450 C 焼戻し材の約 1/100 となる. 両者の体積分率変化はほとんどない. この点からも 450 C 焼戻し試料で形成した「直径 1 nm 程度の組成不均一領域」がいかに高数密度であるかが明らかである.

以上,実験事実と解釈とを明確にするために 450 ℃の 小角測定において得られた結果を整理しておく.

- (1) 450℃において nm スケールの高密度の散乱長密度不均一領域が形成 (一切の仮定,推測は含まれない)
- (2) 形成した不均一領域のサイズは 1 nm である (球形, サイズ分布幅 0.1 nm 程度と仮定)
- (3) 形成した相は窒素の濃化領域と考えられる (これまでの実験結果, 熱処理温度から起こりうる変化から導ける解釈)
- (4) 窒素濃化領域の数密度は 0.045 nm-3 程度かそれ以上(形成可能な相のうち、最も小さな数密度を与える CrN から推定)
- (5) 過時効試料 (550 ℃焼戻し材) と比較して数密度はおよそ 100 倍 (窒素濃化領域の散乱長密度 (濃度) 変化が小さい場合を仮定, 不均一領域と母相との濃度差が高温で大きい場合にはこの差はさらに大きくなる.)

これまで我々は小角散乱の適用を TEM 観察で析出物を 特定後、その平均サイズ、体積分率を定量化する目的で 進めてきた. 本研究はそれとは異なり、TEM では観察が 難しい条件(鉄鋼材料中の 1 nm 前後の整合析出、あるい は軽元素のクラスタリング) の組織変化に小角散乱法が 適用できた例である.しかし.小角散乱の定量性を真に 発揮するためには形成された相の散乱長密度の特定が必 要であり、このための最短の道は TEM 観察による対応す る相の同定であることを改めて指摘しておく.とはいえ, 今後、析出の極初期段階の実用材料への利用やそのプロ セスの研究推進に小角散乱法単独である程度知見を得る ことが必要となってくることも予想される. その可能性 を示すデータとして 500 ℃熱処理材の SANS (核散乱成 分)と SAXS プロファイルを Fig.7 に示した. 同一試料 を測定しているのであるから式(10)中の数密度 n と体積 V(D) は変わらず、絶対強度化した強度単位で両者の強度 差を決めているのは観測している相のプローブビームに 対する散乱長密度差、 $\Delta \rho$ である。そこで Fig. 6 で示し

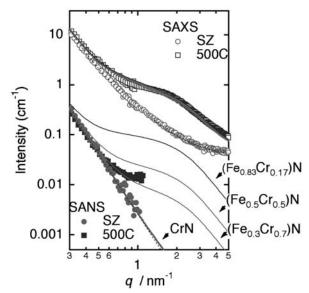


Fig.7. Comparison of absolute intensity between SAXS and SANS profiles for the alloy tempered at 500C (markers). Simulated profiles (solid, dotted and broken lines) are calculated as MX type nitride with different Fe/Cr ratio. The lattice constant is fixed at 0.414 nm independent of Fe/Cr ratio. Scattering length densities,  $\rho_{\rm X}$  (for Xray) and  $\rho_{\rm N}$  (for neutron) for each compositions are following; (Fe<sub>0.83</sub>Cr<sub>0.17</sub>)N:  $\rho_{\rm X}$  =5.19  $\times$  10<sup>11</sup>,  $\rho_{\rm N}$  =1.00  $\times$  10<sup>11</sup> cm<sup>-2</sup>, (Fe<sub>0.5</sub>Cr<sub>0.5</sub>)N:  $\rho_{\rm X}$  =5.09  $\times$  10<sup>10</sup>,  $\rho_{\rm N}$  =8.96  $\times$  10<sup>10</sup> cm<sup>-2</sup>, (Fe<sub>0.3</sub>Cr<sub>0.7</sub>)N:  $\rho_{\rm X}$  =5.02  $\times$  10<sup>10</sup>,  $\rho_{\rm N}$  =8.31  $\times$  10<sup>10</sup> cm<sup>-2</sup>.

たフィッティング結果から得られた粒子サイズを使用し, 種々の Fe/Cr 比を有する MX 型の窒化物について SAXS 強度から見積った体積分率を用いて SANS プロファイル を計算した. 各元素の散乱長は X 線では原子番号順に大 きくなるのに対し、中性子では特にそのような順序はな く、Table 1 に示したように Cr は N の散乱長よりも小さ いといったユニークな特徴がある。このため、鉄原子が 完全に掃き出された CrN 相(体積分率 0.037)では SANS 強度が小さくなり、サブゼロ試料とほとんど変わらない 散乱強度となる. 一方, 平均組成の Fe/Cr 比と同じ MX 型窒化物を想定すると、X線に対する母相との散乱長密 度差が小さくなり、測定 SAXS プロファイルを説明する には大きな体積分率 (=0.07) を必要とする. このため, 同じ体積分率を使って計算した SANS プロファイルでは 観測強度を大幅に上回ってしまう. したがって, これら の考察結果は窒化物領域で Cr の濃縮が既に始まってい ることを示唆している. ここでは Fe/Cr 比が変化しても, MX 窒化物の格子定数は変化しない(a=0.413 nm)とい う不完全なモデルであるが、この範囲内では ( $Fe_{0.3}Cr_{0.7}$ )N が SANS, SAXS 強度のどちらも説明可能 (体積分率 0.04) でCr濃度が鉄濃度の倍程度まで濃縮していると解釈でき る. 析出初期段階においては溶質分配が明瞭に行われず, 多成分からなる相が形成することも多く, 形成相の組成 をこのような手法で特定することは困難であるが、種々

の熱処理条件間で比較が可能となれば、析出物の組成が どのように変化しているかを SAXS と SANS の強度比か ら議論できる. 現時点では観測q領域の制約からそのよ うな検討は不可能であるが、J-PARC の稼働後は SAXS、 SANS を同じq領域で測定し、ナノ析出物のサイズと組 成変化の関係を議論できるケースが増加し、ナノ組織解 析における重要な利用法の一つとなると期待される.

### 5. おわりに

以上、本稿では小角散乱法の測定と解析について、実 践的な解説を試みた.一方で、高窒素マルテンサイト鋼 自体のユニークさにはふれることができなかった. この 点は既報の論文1),16)を参考にされたい。また、小角散乱 の原理についても簡単に触れるに留めた. これについて も既報の解説や論文を参考にされたい、中性子小角散乱 は非破壊状態での評価が可能であり、J-PARC による高輝 度中性子源を利用すれば金属材料においても高温での時 分割測定が可能になるケースも増えてくることが期待さ れる. J-PARC では小角領域の簡易測定が可能な装置が 2008年末より使用可能になり、また、小角専用の測定装 置が約2年後には稼働し、金属材料研究にも使用できる マシンタイムが飛躍的に増加する. これらに加え、放射 光の産業利用ビームラインによる小角散乱測定や Mo-Ka 線源の実験室装置を利用した小角散乱装置など、金属材 料に利用できる小角散乱装置が充実しつつある.「微細組 織を制御して特性を向上させる」という金属材料ならで はの材料開発研究において、「微細組織の平均情報」を「定 量的に」「比較しやすく」得られる小角散乱法は企業にお いても利用価値の高い測定法であると考えられる. 産業 界からの積極的な利用を期待し、本稿がその一助となれ ば幸いである.

#### 謝辞

本稿で紹介した高窒素マルテンサイト鋼の研究は茨城 大学 小島真由美氏, 友田陽教授, 大同特殊鋼(料植田茂 紀氏, 成田修二氏, 清水哲也氏との共同研究の成果であり, ここに謝意を表します. また, 本研究の一部は鉄鋼協会 産発プロジェクト「中性子利用鉄鋼評価技術の基礎検討 に関わる研究」として進められており, ここに謝意を表 します.

#### (文献)

 M.Ojima, M. Ohnuma, J. Suzuki, S.Ueta, S.Narita, T.Shimizu and Y. Tomota: Scripta Mater. (2008), in print (doi:10.1016).

- 2) 宝野和博, 弘津禎彦 編:金属ナノ組織解析法, アグネ技術センター, 2006, 297(「X線・中性子小角散乱(担当:大沼正人)」.
- 3) 大沼正人, 鈴木淳市: 分析化学, 55 (2006), 381.
- 4) 大沼正人, 鈴木淳市: ふぇらむ, 11 (2006), 631.
- 5) A.J.C Wilson (editor): International Tables for Crystallography Vol.C, Academic Publisher, 1992, 193.
- 6) 早稲田嘉夫, 松原英一郎: X 線構造解析, 内田老鶴圃, 1998, 276.
- 7) A.J.C Wilson (editor): International Tables for Crystallography Vol.C, Academic Publisher, 1992, 445.
- 8) NIST ホームページ http://www.ncnr.nist.gov/resources/n-lengths/
- 長尾道弘, 柴山充弘:日本中性子科学会誌, 12 (2002),
   34.
- 10) 遠藤康夫:日本中性子科学会誌, 18 (2008), 2.
- 11) 永宮正治:日本中性子科学会誌, 18 (2008), 7.
- 12) 山崎義成:日本中性子科学会誌, 18 (2008), 13.
- 13) 二川正敏, 神永雅紀, 前川藤夫, 坂元真一:日本中 性子科学会誌, **18** (2008), 22.
- 14) 池田祐二郎: 日本中性子科学会誌, 18 (2008), 27.
- 15) 金谷利治:日本中性子科学会誌, 18 (2008), 32.
- 16) 濱野修次, 清水哲也, 野田俊治:電気製鋼, 77 (2006),107.
- 17) H. Berns, S. N. Bugajchuck, V. A. Duz, R. Ehrhardt, V.G.Gavriljuk, Y.N.Petrov and A.Yakubzov: Steel Research, 65(1994), 444.
- 18) F.Vanderscheave, R.Taillard and J. Foct: Steel Research, 64(1993), 221.